

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【公開番号】特開2007-223932(P2007-223932A)

【公開日】平成19年9月6日(2007.9.6)

【年通号数】公開・登録公報2007-034

【出願番号】特願2006-45525(P2006-45525)

【国際特許分類】

C 07 C 67/58 (2006.01)

C 07 C 69/54 (2006.01)

C 07 C 67/08 (2006.01)

C 08 F 20/10 (2006.01)

【F I】

C 07 C 67/58

C 07 C 69/54 B

C 07 C 67/08

C 08 F 20/10

【手続補正書】

【提出日】平成21年1月5日(2009.1.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

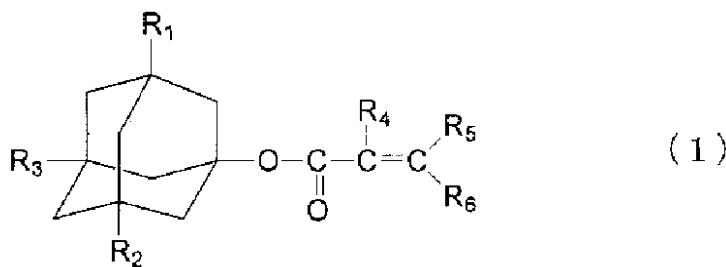
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

アダマンタノール類と、メタクリル酸誘導体またはアクリル酸誘導体とを原料として、一般式(1)で表される高純度アダマンチル(メタ)アクリレート類を製造する方法において、粗アダマンチル(メタ)アクリレート類中をアルカリ性水溶液で洗浄することを特徴とする高純度アダマンチル(メタ)アクリレート類の製造方法。

【化1】



(式中、R₁～R₃は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1～20のアルキル基、エーテル基を有する炭素数1～20のアルキル基、炭素数1～20のハロゲン含有アルキル基を示す。R₄～R₆は水素原子、炭素数1～6のアルキル基、ハロゲン原子、炭素数1～20のハロゲン含有アルキル基を示す)。

【請求項2】

洗浄後に残留する無機アニオン濃度が100 ppm以下である請求項1記載の高純度アダマンチル(メタ)アクリレート類の製造方法。

【請求項3】

無機アニオンがハロゲン類、硫酸イオン、硝酸イオンまたはリン酸イオンである請求項

2 記載の高純度アダマンチル(メタ)アクリレート類の製造方法。